

が分かった。これはまさに分子のキラリティを反映した磁気抵抗効果と言える。このようなキラル分子由来の磁気抵抗効果の発現は、キラル分子が磁石として働いていることを意味している。そして、今回の実験では、キラル分子に電流が流れていないことから、キラル分子は電流印加がなくても磁石になる(スピン偏極する)ことを明確に示している。

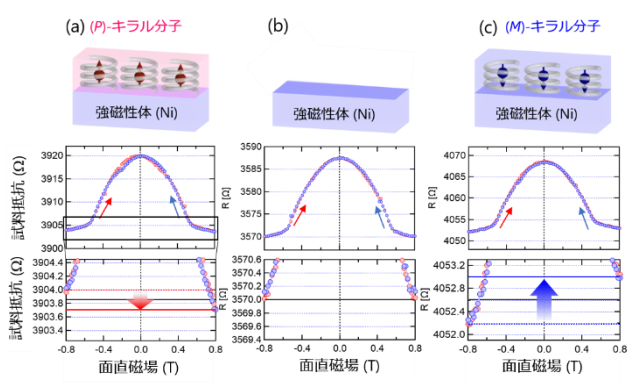


図2| 分子キラリティに依存した磁気抵抗効果
(a) (P)-キラル分子/強磁性体(Ni)薄膜 (b) 強磁性体(Ni)薄膜 (参照試料) (c) (M)-キラル分子/強磁性体(Ni)薄膜

次に、このキラル分子による磁気抵抗効果の起源を調べるために、デバイス温度依存性を調べた(図3)。その結果、磁気抵抗効果は 50 K(約-223℃)からデバイスを温めるほど大きくなるのが分かった(図3c)。これは、一般的な鉄などの磁石とは異なり、キラル分子が熱によって磁化が大きくなる磁石であることを示している。

このような温めるほど磁気抵抗効果が大きくなる結果は、熱によって金属から分子への電荷移動(ホッピング)が増加することで、キラル分子内のスピン偏極が増大していると推察される。金属からキラル分子に移動した電子はスピン偏極(例えば上向き)する。逆にキラル分子から金属にもどる場合も逆向きにスピン偏極(下向き)するが、分子内と金属内ではスピン緩和時間が大きく異なる(分子>>金属)ために、キラル分子内においてスピン偏極が残る(発現する)ことで、磁気抵抗効果が観測された可能性が考えられる。

2. まとめと将来展望

これまで、キラル分子におけるスピン機能は、分子に電流を流すことで研究されてきた。しかし、本研究では、キラル分子に電流を流さなくても、金属と触れさせるだけで、キラル分子が本質的に磁石としての性質が発現することを見出した。このキラル分子におけるスピン機能の発現に関する新たな知見は、キラル分子科学およびスピントロニクスにおける基礎として重要であるだけでなく、今後、幅広

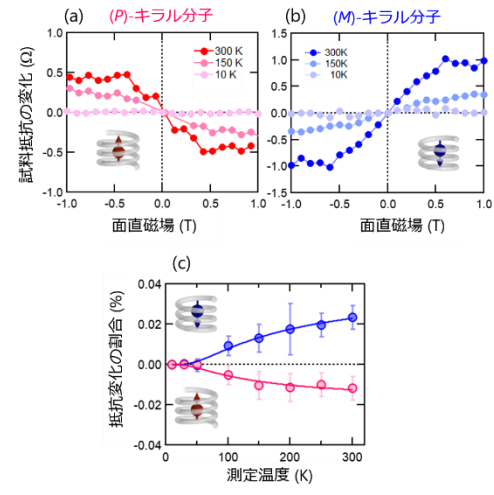


図3| キラル分子誘起磁気抵抗効果の温度依存性
(a)(P)-キラル分子/Ni 薄膜 (b)(M)-キラル分子/Ni 薄膜 (c) 抵抗変化の割合の温度依存性

い研究分野において、この新機能を用いた新たな分子デバイスが設計されるものと期待できる。

謝辞

本研究成果は、東京大学 物性研究所 志賀雅亘 特任研究員(現 九州大学 助教)、坂本祥哉 助教、三輪真嗣 准教授、理化学研究所 宮島大吾ユニットリーダー、荒岡史人チームリーダー 東京大学 附属スピントロニクス学術連携研究教育センター 小林正起 准教授 との共同研究によるものです。本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(18H03880, 19H02586)の一環として行われた。

[1] K. Ray, S. P. Ananthavel, D. H. Waldeck, & R. Naaman, *Science* **283**, 814 (1999).
 [2] C. Kulkarni, A. K. Mondal, T. K. Das, G. Grinbom, F. Tassinari, M. F. J. Mabesoone, E. W. Meijer & R. Naaman, *Adv. Mater.* **32** e1904965 (2020).
 [3] O. Ben Dor, S. Yochelis, A. Radko, K. Vankayala, E. Capua, A. Capua, S.-H. Yang, L. T. Baczewski, S. S. P. Parkin, R. Naaman & Y. Paltiel, *Nat Communications* **8**, 14567 (2017).
 [4] S. Miwa, K. Kondou, S. Sakamoto, A. Nihonyanagi, F. Araoka, Y. Otani & D. Miyajima, *Applied Physics Express* **13**, 113001 (2020).
 [5] K. Kondou, M. Shiga, S. Sakamoto, H. Inuzuka, A. Nihonyanagi, F. Araoka, M. Kobayashi, S. Miwa, D. Miyajima & Y. Otani, *J. Am. Chem. Soc.* **144**, 7302-7307 (2022).